

ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

表面側から所定の集束イオンビームが照射されて断面が形成された試料を固定するための試料ホルダーと、試料ホルダーにより固定された試料の、上記断面を含む領域に気体イオンビームを照射して上記断面上のダメージ層を除去する気体イオンビーム照射装置とを有する。気体イオンビーム照射装置からの気体イオンビームが、試料の裏面側から上記断面に所定の入射角度で照射される。